

Journées Nationales de la Lithographie par NanoImpression

JNIL 2023, 11 et 12 Mai 2023, Lyon La Doua

	Judi 11/05	Vendredi 12/05
8:00		accueil
8:15		
8:30		
8:45		Haison Nguyen (INL) "Nanostructuration of Hybrid Organic-Inorganic perovskite via Thermal Nanoimprint to tailor light-matter interactions for optoelectronic devices"
9:00		Jean-Baptiste Doucet (LAAS) : "étude de la nanoimpression dans un biomatériau et de son utilisation comme moule souple intermédiaire"
9:15		Jean-Louis Leclercq (INL) : "Etude du transfert d'une résine biosourcée par nanoimpression thermique"
9:30		Maximilien Billet (IMEC, Ghent) : "Filling the gap of silicon nitride photonic platform functionalities using micro-transfer printing"
9:45		Coffee break
10:00		Marco Abbarchi (IM2NP) : "Scaling the Nanoimprint Lithography Process of Inorganic-Based Materials"
10:15		Jérôme Reche (CEA Leti) : "Nano-impression : alignement et distorsions"
10:30		Vision Industrielle : Eugénie Peyroux : "activités industrielles du groupe AGC Glass Europe autour de la micro-texturation"
10:45		Table ronde : organisation du réseau RénIL et questions diverses
11:00		Conclusion sur les journées
11:15		
11:30		
11:45		
12:00		
12:15		
12:30		
12:45	Arrivée des participant(e)s	
13:00		
13:15	Discours d'accueil : Ségolène Callard (Dir. Adj. INL) et resp. journées - infos générales	
13:30	Isabel Rodriguez (IMDEA Nanoscience): "Nanoimprint lithography and hybrid processes to produce complex nanostructures"	Lunch & discussions
13:45		
14:00	Maxime Gayraud (INL) : "Nanostructuration directe de couche sol-gel par embossage à chaud"	
14:15	Huiru Ren (INL): "TiO2 nanoimprint for photonic sensor application "	
14:30	Lydie Ferrier (INL) : "Réalisation de structures nanophotoniques superposées (moirés) par procédé de NanoPatterning Stepper"	
14:45	Didem Dede (EPFL) : The implementation of UV and thermal nanoimprint lithography for selective area epitaxy	
15:00		
15:15		
15:30	Coffee break	
15:45	Yoann Blancquaert (CEA Leti): « La scatterométrie pour la mesure des procédés de lithographie par Nano Impression »	
16:00		
16:15	Yann Chevolot (INL) : "Modifications de la surface des oxydes via la réaction de silanisation"	
16:30	Yves Jourlin (LHC) : "Texturation et fonctionnalisation de surface au sein de Manutech"	
16:45		
17:00	Sébastien Mouchet (Unamur) : "Bioinspired photonics for tomorrow's technological applications"	
17:15		
17:30	Stéphane Collin (C2N): "Nanoimpression pour le PV : résultats et perspectives"	
17:45		
18:00		
18:15		
18:30	Discussions - stands industriels - cocktail	
18:45		
19:00	Dîner au Restaurant Le Vatel https://www.restaurantvatel.fr/fr/lyon	

20 min + 10

10 min + 5